(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



) (1881) 1891) (1891) (1891) (1891) (1891) (1891) (1891) (1893) (1893) (1893) (1893) (1893) (1893) (1893) (1893)

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. September 2003 (12.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/075097 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

G03F 7/20

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP03/01651

(22) Internationales Anmeldedatum:

19. Februar 2003 (19.02.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

60/360,845

1. März 2002 (01.03.2002) US

102 21 243.0

13. Mai 2002 (13.05.2002) DE

102 29 249.3

28. Juni 2002 (28.06.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CARL ZEISS SMT AG [DE/DE]; Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen (DE).

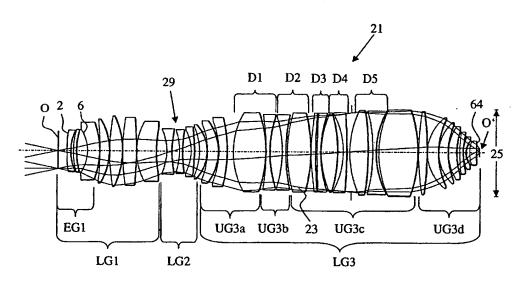
(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHUSTER, Karl-Heinz [DE/DE]; Rechbergstrasse 24, 89551 Königsbronn (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: REFRACTIVE PROJECTION LENS WITH A MIDDLE PART
- (54) Bezeichnung: REFRAKTIVES PROJEKTIONSOBJEKTIV MIT EINER TAILLE



(57) Abstract: Disclosed is a refractive projection lens used in microlithography, which comprises a lens array in which all lenses are made of one material, and which has a numerical aperture (NA) of more than 0.7 on the image side. The light beam (23) transmitting through the lens array (21) is greater than 85 percent of the largest diameter (25) of the light beam or the maximum lens diameter in the area located upstream from a system diaphragm (19) which is disposed in the lens array (21) along a distance that is equal to the greatest diameter (25) of the light beam or the maximum lens diameter in the lens array (21).

(57) Zusammenfassung: Refraktives Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie mit einer Linsenanordung bei dem alle Linsenanordung einem Material bestehen und das eine bildseitige numerische Apertur (NA) von grösser 0,7 aufweist, wobei das die Linsenanordung (21) transmittierende Lichtbündel (23) im Bereich vor einer in der Linsenanordung (21) angeordneten Systemblende (19) auf der Länge gleich dem grössten Lichtbündeldurchmesser (25) oder des maximalen Lindsendurmessers in der Linsenanordnung (21) grösser als 85% des grössten Lichtbündeldurchmessers (25) oder des maximalen Linsendurchmessers ist.



075007



(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

-- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung:

Refraktives Projektionsobjektiv mit einer Taille

Die Erfindung betrifft eine Projektionsbelichtungsanlage mit einem refraktiven Projektionsobjektiv, ein refraktives Projektionsobjektiv selbst sowie ein Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile bei dem eine Projektionsbelichtungsanlage mit einem refraktiven Projektionsobjektiv verwendet wird. Bei diesem refraktiven Projektionsobjektiv bestehen alle Linsen aus einem Material, wobei das Projektionsobjektiv eine bildseitige numerische Apertur von größer 0,7 aufweist.

Aus der DE 198 18 444 A1 sind refraktive Projektionsobjektive, die für eine Belichtungswellenlänge von 248,4 nm ausgelegt sind, bekannt, wobei die Linsen der Projektionsobjektive aus einem Material bestehen, das bei der Belichtungswellenlänge eine Brechzahl von 1,50839, wie Quarzglas, aufweist.

Weiterhin ist es aus dieser Schrift bereits bekannt, dass auftretende Bildfehler durch den gezielten Einsatz von Asphären korrigiert werden können. So ist es aus dieser Schrift entnehmbar, dass insbesondere durch vorsehen einer Asphäre in der ersten Linsengruppe, bei der es sich um eine Linsengruppe positiver Brechkraft handelt, auftretende Verzeichnung korrigiert werden kann. Weiterhin ist es aus dieser Schrift bekannt, dass durch vorsehen einer Asphäre in der zweiten Linsengruppe, die negative Brechkraft aufweist und durch die eine erste Taille gebildet wird, auftretende Eintrittspupillenaberrationen korrigiert werden können. Weiterhin ist es bekannt, dass durch vorsehen einer asphärischen Linsenoberffäche in der dritten Linsengruppe auftretendes Koma minimiert werden kann, wobei die dritte Linsengruppe positive Brechkraft aufweist und zwischen den zwei Taillen, zweite und vierte Linsengruppe angeordnet ist. Ebenfalls kann durch vorsehen einer Asphäre in der sechsten Linsengruppe, die positive Brechkraft aufweist und direkt vor dem Wafer angeordnet ist, ebenfalls das Auftreten von Koma minimiert werden. Durch vorsehen einer Asphäre in der fünften Linsengruppe, die positive Brechkraft aufweist, können insbesondere mit hoher numerische Apertur zusammenhängende Aberrationen, insbesondere sphärische Aberration, korrigiert werden. Eine derartige Korrektur ist auch durch vorsehen einer Asphäre in der vierten Linsengruppe möglich, sofern die Asphäre nahe an der Bildebene angeordnet ist.

Aus der US 5,668,672 ist es bekannt, dass chromatische Aberrationen durch den Einsatz von Quarzglas kombiniert mit einem Fluoridmaterial als Linsenmaterial korrigiert werden können. Weiterhin ist aus der DE 199 39 038 A1 ein refraktives Projektionsobjektiv bekannt, bei dem chromatische Aberrationen durch die Kombination von zwei oder mehr Sorten von Fluoridkristallen korrigiert wird. Weiterhin weist das in Figur 11 gezeigte Projektionsobjektiv, das für die Wellenlänge 157nm ausgelegt ist, mehrere Asphären auf. Für diese Wellenlänge sind insbesondere als Linsenmaterialien Kalziumfluorid und Lithiumfluorid vorgesehen.

Weiterhin ist es aus der US 09/694878 bekannt, insbesondere für die Farbfehlerkorrektur bei einem für die Wellenlänge 193 nm ausgelegten Objektiv einzelne Linsen aus Calciumfluorid für die Korrektur von Abbildungsfehler vorzusehen, wobei die Mehrzahl der Linsen aus Quarzglas besteht. Die numerische Apertur des in Figur 1 gezeigten Projektionsobjektives beträgt 0,7. Dieses refraktive Projektionsobjektiv umfasst eine negative Linsengruppe, durch die eine ausgeprägte Taille bereitgestellt wird, die mit G2 bezeichnet ist.

Aus der US 09/44063, EP 1006387, ist ein Projektionsobjektiv bekannt, das eine Linsenanordnung, die ebenfalls für die Wellenlänge von 193nm ausgelegtes ist. Diese Linsenanordnung weist eine numerische Apertur von 0,7 auf. Bei dieser Linsenanordnung ist wiederum eine Materialmischung von Quarzglas und Calciumfluorid vorgesehen. Weiterhin weisen die aus dieser Schrift bekannten Projektionsobjektive mindestens zwei Linsengruppen mit negativer Brechkraft auf, durch die jeweils deutlich eine Taille ausgebildet wird.

Aus der EP 1 139 138 A1 sind refaktive Linsenanordnungen bekannt, wobei die eingesetzten Linsen aus den Materialien Calciumfluorid und Quarzglas bestehen. Es ist ein Ausführungsbeispiel gezeigt, bei dem alle Linsen aus Calciumfluorid bestehen, wobei dieses Objektiv für eine Belichtungswellenlänge von 157nm ausgelegt ist. Die weiteren gezeigt Linsenanordnungen sind für die Belichtungswellenlänge von 193nm ausgelegt. Alle gezeigten Linsenanordnungen weisen eine Mehrzahl von Asphären auf.

Der Einsatz beispielsweise von Calciumfluorid bei einer für die Belichtungswellenlänge von 193nm ausgelegten Linsenanordnung ist mit dem Nachteil verbunden, dass dieses Material zum einen schwerer verfügbar ist wie Quarzglas und zum anderen auch wesentlich teurer ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, refraktive Linsenanordnungen bzw. eine Projektionsbelichtungsanlage für Mikrolithographie mit einem refraktiven Projektionsobjektiv mit einer hohen numerischen Apertur und guten optische Eigenschaften bereitzustellen.

Weiterhin lag der Erfindung die Aufgabe zugrunde, refraktive Linsenanordnungen für die Mikrolithographie zu schaffen, die sich bei hoher numerischer Apertur durch geringe Farblängsfehler auszeichnen.

Weiterhin lag der Erfindung die Aufgabe zugrunde refraktive Linsenanordnungen bereitzustellen, dessen Herstellkosten reduziert sind.

Die der Erfindung zu Grunde liegenden Aufgaben wurde durch die im Patentanspruch 1 gegebenen Merkmale gelöst. Durch die Maßnahme, dass alle Linsen aus einem Material bestehen, konnten die Herstellkosten reduziert werden, da schon allein dadurch, dass unterschiedlichste Materialien beschafft werden müssen, höhere Kosten verursacht werden, vermieden wurde.

Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, ein rein refraktives Objektiv aus nur einem Linsenmaterial anzugeben, dass als Mikrolithographie-Projektionsobjektiv mit großer bildseitiger numerischer Apertur und großem Bildfeld bezüglich auftretender Farbfehler eine gute Korrektur aufweist. Da die Farbfehler mit zunehmender Bandbreite des Beleuchtungslichtes zunehmen, wurde es erst durch den Einsatz eines in bezug auf die Farbfehler, insbesondere Farblängsfehler, besonders gut korrigierten Objektives möglich, die Anforderungen an eine Einengung der Bandbreite des Beleuchtungslichtes zu reduzieren, ohne das eine Verschlechterung der Bildqualität akzeptiert werden musste.

Das Objektiv soll besonders für die Wellenlängen 157 Nanometer und 193 Nanometer geeignet sein. Überraschend wurde gefunden, dass auch unter den komplexen Randbedingungen eines hochwertigen Mikrolithographie-Projektionsobjektives Maßnahmen hinsichtlich der Anordnung und Ausbildung der Linsen möglich sind, die für ein Linsenmaterial mit gegebener Dispersion eine deutliche Senkung der chromatischen Längsaberration ergeben, so hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, positive Brechkraft zum Bild hin zu verschieben, um den Farblängsfehler klein zu

halten. Negative Linsen mit kleinem Bündelquerschnitt müssen objektseitig fern der Systemblende angeordnet sein.

Die für eine derartige Linsenanordnung notwendige hochwertige Petzval-Korrektur erfordert die Ausbildung von Taillen mit negativer Brechkraft. Durch die Maßnahme negative Linsen mit kleinem Büschelquerschnitt objektseitig, fern der Systemblende anzuordnen, kann der Farblängsfehler klein gehalten werden. Es hat sich weiterhin als vorteilhaft herausgestellt, positive Brechkraft zum Bild hin zu verschieben.

Die Anordnung von aus einer Positivlinse und einer Negativlinse bestehenden Dubletts nach der ersten Taille mit großem Linsendurchmesser von mindestens 85 % des maximalen Linsendurchmessers bzw. Lichtbüscheldurchmessers, geben eine optimale Korrekturmöglichkeit bezüglich aller aperturbehafteter außeraxialer Bildfehler ohne eine Erzeugung von Farblängsfehlern.

Gerade der Bereich vor der Systemblende und der Blendenbereich selbst ist prädestiniert für das entstehen von Farblängsfehlern. Aufgrund dieser Problematik hat sich als vorteilhaft herausgestellt, in dem Bereich vor und um die Systemblende herum Dubletts anzuordnen, bei denen jeweils eine Positivlinse vorgesehen ist, der ein nahestehender Partner umgekehrter Brechkraft bei ähnlichen Lichtbüscheldurchmesser zugeordnet ist. Es hat sich insbesondere als vorteilhaft herausgestellt Dubletts vorzusehen, die eine Gesamtbrechkraft aufweisen, die kleiner ist als 20% der Brechkraft zwischen Blende und Wafer beträgt. Die äußere Form der Dubletts gleicht einem dicken durchgebogenen Meniskus, der eine relativ geringe Brechkraft ausweist.

Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt einen Rest einer zweiten Taille durch zwei aufeinanderfolgende negativ Linsen, die zwischen zwei positiv Linsen angeordnet sind vorzusehen. Aufgrund des großen Linsendurchmessers dieser Negativlinsen wird der Lichtbündeldurchmesser in dieser zweiten Taille nur geringfügig, insbesondere weniger als 10%, ausgehend von dem maximalen Linsendurchmesser vor dieser Taille eingeschnürt, was sich vorteilhaft auf den Farblängsfehler auswirkt. Der Farblängsfehler wird auch mit chromatischer Längsaberration bezeichnet.

Durch den Einsatz von Asphären in einer Eröffnungslinsengruppe, die aus Negativlinsen besteht, wird eine Entspannung der Möglichkeiten der Petzvalkorrektur, insbesondere der Bildschalenkorrektur, erreicht. Weitere vorteilhafte Maßnahmen sind in weiteren Ansprüchen beschrieben.

Anhand der folgenden Ausführungsbeispiele wird die Erfindung näher beschrieben. Diese Beispiele sind nicht einschränkend zu verstehen. Es zeigt:

- Figur 1: Projektionsbelichtungsanlage für die Mikrolithographie;
- Figur 2: Refraktives Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie für die Belichtungswellenlänge 193nm, dass bei einer Baulänge von 1340,7 mm eine numerische Apertur von 0,8 aufweist;
- Figur 3: Projektionsobjektiv für die Wellenlänge 193nm, dass bei einer Baulänge von 1344 mm eine numerische Apertur von 0,85 aufweist;
- Figur 4: Projektionsobjektiv für die Belichtungswellenlänge 157nm, dass bei einer Baulänge von 1390 mm eine numerische Apertur von 0,85 aufweist;
- Figur 5: Projektionsobjektiv für die Wellenlänge 157 nm mit einer Baulänge von 1300 mm;
- Figur 6: Projektionsobjektiv für die Wellenlänge 193 nm mit einer Baulänge von 1200 mm

Anhand von Figur 1 wird zunächst der prinzipielle Aufbau einer Projektionsbelichtungsanlage 1, die ein refraktives Projektionsobjektiv 5 umfasst, beschrieben. Die Projektionsbelichtungsanlage 1 weist eine Belichtungseinrichtung 3 auf, die mit einer Einrichtung zur Einengung der Bandbreite versehen ist. Das Projektionsobjektiv 5 umfasst eine Linsenanordnung 21 mit einer Systemblende 19, wobei durch die Linsenanordnung 21 eine optische Achse 7 definiert wird. Zwischen Belichtungseinrichtung 3 und Projektionsobjektiv 5 ist eine Maske 9 angeordnet, die mittels eines Maskenhalters 11 im Strahlengang gehalten wird. Solche in der Mikrolithographie verwendeten Masken 9 weisen eine Mikrometer- bis Nanometerstruktur auf, die mittels des Projektionsobjektives 5 bis zu einem Faktor von 10, insbesondere um den Faktor 4, verkleinert auf eine Bildebene 13 abgebildet werden. In der Bildebene 13 wird ein durch einen Substrathalter 17 positioniertes Substrat bzw. ein Wafer 15 gehalten. Die noch auflösbaren minimalen Strukturen hängen von der Wellenlänge des für die Belichtung verwendeten Lichtes sowie von

der numerischen Apertur des Projektionsobjektives 5 sowie von dem K Faktor der Belichtungseinrichtung 3 ab. Eine maximal erreichbare Auflösung der Projektionsbelichtungsanlage 1 nimmt mit abnehmender Wellenlänge des durch die Belichtungseinrichtung 3 bereitgestellten Lichtbüschels 23, durch den das Muster der Maske 9 mittels des Projektionsobjektives 5 auf den Wafer 15 abgebildet wird, zu.

Anhand der Figuren 2-6 wird der Aufbau verschiedener Linsenanordnungen 21 der Projektionsobjektiven 5, die für die Wellenlängen 193nm und 157,6 nm ausgelegt sind, beschrieben.

Die in Figur 2 dargestellte refraktive Linsenanordnung 21 ist für die Belichtungswellenlänge von 193 Nanometer ausgelegt und weist eine bildseitige numerische Apertur von 0,8 auf. Diese Linsenanordnung 21 umfasst 31 Linsen, von denen 9 mindestens eine asphärische Linsenoberfläche aufweisen. Solche Linsen werden auch mit Asphäre bezeichnet. Die Baulänge von Objektebene 0 zu Bildebene 0' beträgt 1340,7 mm.

Diese Linsenanordnung 21 ist in drei Linsengruppen LG1 bis LG3 unterteilbar. Die erste Linsengruppe LG1 weist positive Brechkraft auf und umfasst die Linsen mit den Flächen 2-15. Diese Linsengruppe ist wiederum unterteilbar in eine Eröffnungsgruppe EG1, die negative Brechkraft aufweist und die ersten drei Linsen umfasst. Die ersten beiden objektseitig angeordneten Linsen sind auf der dem Objekt zugewandten Seite mit einer Asphäre versehen, die auf einer konvexen Linsenoberfläche angeordnet ist. Diese ersten beiden Linsen weisen eine Durchbiegung zum Objekt hin auf.

Durch die auf die Eingangsgruppe EG1 folgenden Linsen wird ein Bauch gebildet. Diese dicken Positivlinsen haben einen positiven Effekt in Bezug auf die Petzvalsumme. Die letzte Linse der Linsengruppe LG1 ist auf der waferseitig angeordneten Linsenoberfläche asphärisiert. Diese dicken Positivlinsen liefern zusätzlich einen günstigen Beitrag in Bezug auf die Komakorrektur.

Die zweite Linsengruppe LG2 umfasst die Linsen mit den Linsenoberflächen 16-21. Die erste und die letzte Linsenoberfläche dieser Linsengruppe ist jeweils asphärisiert. Diese Linsengruppe weist negative Brechkraft auf und es wird durch diese Linsengruppe eine deutlich ausgeprägt

Taille gebildet. Damit liefert diese Linsengruppe einen besonders wertvollen Beitrag zur Korrektur der sagitalen sphärischen Bildfehler höherer Ordnung. Gleichzeitig liefert die negative Gruppe den Hauptbeitrag zur Petzvalkorrektur, insbesondere zur Bildschalenebnung.

Auf die zweite Linsengruppe folgt die dritte Linsengruppe LG3, die durch die Linsen mit den Linsenoberflächen 22-64 gebildet wird. Diese Linsengruppe LG3 fällt durch ihre langgestreckte röhrenförmige Erscheinung auf. Durch einen langgestreckten Bereich vor der Systemblende 19, der einen Lichtbüscheldurchmesser bzw. einen Linsendurchmesser aufweist, der mindestens 85 % des maximalen Linsendurchmessers bzw. maximalen Linsenbüscheldurchmessers beträgt, geprägt. Durch die Ausbildung eines derartigen Bereichs konnten unter Verwendung eines einzigen Linsenmaterials gute optische Eigenschaften, insbesondere im Bezug auf eine chromatische Längsaberration, erreicht werden. Gerade dieser Bereich vor der Systemblende 19 und der Bereich der Systemblende 19 selbst, ist für die Entstehung chromatischer Längsaberration besonders empfindlich. In diesem Ausführungsbeispiel sind vier Dubletts bestehend aus jeweils einer Positivlinse und einer Negativlinse vor der Systemblende 19 angeordnet. Ein weiteres Dublett bestehend aus einer Positivlinse gefolgt von einer Negativlinse ist nach der Systemblende 19 angeordnet. Durch eine auf diese Dubletts folgende dicke Positivlinse wird ein Grossteil der Brechkraft des Projektionsobjektives bereitgestellt. Ein Endbereich der dritten Linsengruppe LG3, der mit UG3d bezeichnet ist und die Linsen mit den Flächen 31-54 umfasst, wirkt sich vorteilhaft auf die negative Verzeichnung aus. Die Ausbildung dieses Endbereiches UG3d trägt auch zur Bereitstellung einer sehr hohen numerischen Apertur von 0,8 wesentlich bei und zwar durch kleine Einzelbeiträge zur sphärischen Aberration und Komazahl.

Eine schwach ausgebildete Taille durch zwei aufeinanderfolgende negativ Linsen, die vor der Systemblende angeordnet sind, sind mit UG3b bezeichnet. Durch die Linsen mit den Linsenoberflächen 22-29, mit UG3A bezeichnet, wird eine positive Untergruppe gebildet, die "entartet" einen Bauch darstellt.

Durch das in Figur 2 beschriebene Projektionsobjektiv ist eine Fläche 10,5x26 mm belichtbar, wobei die Struktur des Objektives um den Faktor 4 verkleinert auf den Wafer abgebildet werden.

TABELLE 1

MI	/Ia

TATI				BRECHZAHL	1/2 FREIER
FL	RADIEN	DICKEN (LAESER	193.304nm	DURCHMESSER
					DORGINIZEDELIK
0	0.000000000	24.114319875	N2	1.00000320	56.080
1	0.000000000	3.482434220	N2	1.00000320	61.002
2	2078.963770280A			1.56028895	62.455
	149.559792284	8.045820053	N2	1.00000320	63.745
	283.335388909AS	10.384447026	SIO2HL	1.56028895	65.015
	227.471174739	35.446688452	N2	1.00000320	66.284
	-122.782367295	38.508940817	SIO2HL	1.56028895	68.210
	-255.078934826	0.874570041	N2	1.00000320	89.183
	-888.725542480	30.171005105	SIO2HL	1.56028895	95.735
	-191.846579966	0.675200957	N2	1.00000320	98.735
10	640.397878968	41.049504805	SIO2HL	1.56028895	108.485
	-250.387321692	0.675200957	N2	1.00000320	109.147
11 12		44.017612594	SIO2HL	1.56028895	105.073
	667.678997977		N2	1.00000320	100.899
13	-1125.455416998	0.675200957	SIO2HL	1.56028895	93.072
14	192.876693777	62.505832714		1.00000320	76.483
15	331.893780633A			1.56028895	70.652
16	-171.193877443A				66:301
17	335.138365959	24.373437146	N2	1.00000320	
18	-192.572424355	9.645727950	SIO2HL	1.56028895	65.926
19	418.847934941	26.888457292	N2	1.00000320	68.374
20	-140.483410076	10.610300745	SIO2HL	1.56028895	69.129
21	-459.758634782A			1.00000320	77.669
22	-188.260511338	24.787222412	SIO2HL	1.56028895	79.453
23	-123.558724879	1.174436845	N2	1.00000320	84.227
24	-224.101808279	35.439166118	SIO2HL	1.56028895	89.392
25	-158.235875230	1.137750024	N2	1.00000320	97.007
26	-244.923106839	26.771118597	SIO2HL	1.56028895	99.234
27	-435.595962845	19.019537360	N2	1.00000320	108.190
28	254.503542501	103.741855324		1.56028895	125.704
29	-370.013146990	0.898100644	N2	1.00000320	123.190
30	-651.149669203 <i>A</i>			1.56028895	119.614
31	346.341133415	40.118210584	N2	1.00000320	114.229
32	-378.937108427	11.574873540	SIO2HL	1.56028895	114.195
33	532.696677413	4.927372582	N2	1.00000320	118.682
34	439.556363278	74.374706500	SIO2HL	1.56028895	121.399
35	-502.601956332	0.675200957	N2	1.00000320	124.801
36	522.145069309A			1.56028895	124.414
37	1476.224552423	4.677319062	N2	1.00000320	124.271
38	2177.900420777	11.574873540	SIO2HL	1.56028895	124.349
39	384.316107261	1.595817333	N2	1.00000320	124.241
40	312.429605405	51.750696421	SIO2HL	1.56028895	125.681
41	-432.173779349	17.813396316	N2	1.00000320	125.439
42	-249.375527898	11.574873540	SIO2HL	1.56028895	124.719
43	-1589.233069199	14.468591925	N2	1.00000320	127.374
44	0.000000000	-4.822863975	N2	1.00000320	125.296
45	321.301154865	57,691242734	SIO2HL	1.56028895	131.351
46	-1054.2062056992	AS 14.95179815	7 N2	1.00000320	130.208
47	-589.044474927A			1.56028895	128.575
48	274.036317071	8.139476302	N2	1.00000320	128.119
49	321.225611416	124.977354157	SIO2HL	1.56028895	129.264
50	-395.919230783	1.969428424	N2	1.00000320	131.721
51	820.198727366	26.845651259	SIO2HL	1.56028895	126.931

52	-973.939543882	0.694000123	N2	1.00000320	125.647
53	139.833041863	36.229940671	SIO2HL	1.56028895	107.077
54	242.551698933	. 0.867355440	N2	1.00000320	102.010
55	131.386059685	29.928967379	SIO2HL	1.56028895	91.857
56	235.274124558	0.675200957	N2	1.00000320	85.440
57	157.034314790	26.536117143	SIO2HL	1.56028895	79.168
58	231.201718823	9.219970606	N2	1.00000320	66.512
59	470.035875032	11.197726405	SIO2HL	1.56028895	61.464
60	236.045204498	0.675200957	N2	1.00000320	52.281
61	134.300351512	8.120819966	SIO2HL	1.56028895	48.003
62	63.666959363	10.716266548	N2	1.00000320	38.339
63	108.784923745	21.847901284	SIO2HL	1.56028895	35.245
64	693.402002382	8.681155155	N2	1.00000320	24.992
65	0.000000000	0.000000000	N2	1.00000320	14.020
66	0.000000000	0.000000000		1.00000000	14.020

ASPHAERISCHE KONSTANTEN

FLAECHE NR. 2

- CO 0.0000
- C1 2.14106637e-007
- C2 -1.51669986e-011
- C3 2.64769647e-015
- C4 -3.99036396e-019
- C5 2.47505843e-023
- C6 -3.15802350e-028
- C7 3.03036722e-032
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 4

- CO 0.0000
- C1 8.34485767e-008
- C2 6.40722335e-012
- C3 -1.82542397e-015
- C4 2.34304470e-019
- C5 -8.26711198e-024
- C6 -7.65863767e-028 C7 6.41110903e-032
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 15

- CO 0.0000
- C1 -2.63006449e-008
- C2 -2.79471341e-012
- C3 -2.67096228e-016
- C4 -1.35138372e-020
- C5 -4.40665654e-024
- C6 5.04322571e-028
- C7 -7.87867135e-032
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

- C0 0.0000
- C1 3.25803022e-009
- C2 -6.94860276e-013
- C3 -1.78049294e-016
- C4 -6.94438259e-021
- C5 6.12556670e-024
- C6 -1.48556644e-027
- C7 1.00088938e-031 C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 21

- C0 0.0000
- C1 4.82674733e-008
- C2 1.36227355e-012
- C3 -9.54833030e-017
- C4 9.50143078e-022
- C5 5.69193655e-025
- C6 -3.40684947e-029
- C7 2.94651178e-033
- · C8 0.0000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 30

- C0 0.0000
- C1 -1.45094804e-009
- C2 5.04456796e-013
- C3 -5.09450648e-018
- C4 -1.99406773e-022
- C5 -1.14064975e-026
- C6 5.78307927e-031
- C7 -1.43630501e-035
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 36

- C0 0.0000
- C1 -1.43259985e-008
- C2 -3.56045780e-013
- C3 -7.68193084e-018
- C4 -1.87091119e-022
- C5 -1.28218449e-026 C6 3.62372568e-031
- C7 -2.39455297e-035
- C8 0.00000000e+000
- C9. 0.000000000e+000

- C0 0.0000
- C1 -7.44300951e-010
- C2 -1.00597848e-013
- C3 -1.16300854e-017
- C4 3.24986044e-023

- C5 5.82666461e-027
- C6 -4.12661445e-031
- C7 6.25538499e-036
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 47

- CO 0.0000
- C1 -7.10390913e-009
- C2 1.80939707e-014
- C3 -1.34383300e-017
- C4 -1.50233953e-023
- C5 7.80860338e-027
- C6 -4.98388772e-031
- C7 9.26846573e-036
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

Linsengruppe waferseitig asphärisiert.

Anhand von Figur 3 wird eine rein refraktive Linsenanordnung 21, die für die Belichtungswellenlänge von 157,6 nm ausgelegt ist, näher beschrieben. Die Baulänge dieses Linsenanordnung 21 beträgt 1344,0 mm gemessen von Objektebene 0 zu Bildebene 0'. Es ist ein Feld von 10,5x26 mm² belichtbar. Auch diese Linsenanordnung 21 weist wiederum in eine Eingangsgruppe EG1 auf, die durch die ersten objektseitig angeordneten, eine negative Brechkraft aufweisenden Linsen gebildet wird. Mit den darauffolgenden Linsen mit den Flächen

8-15 wird die Linsengruppe LG1gebildet. Wiederum ist die letzte Linsenfläche 15 dieser

Durch die darauffolgenden Linsen mit den Flächen 16-21 wird eine dritte Linsengruppe LG2 gebildet. Diese dritte Linsengruppe LG2 weist insgesamt negative Brechkraft auf und es wird durch diese Linsengruppe eine deutlich ausgeprägte Taille 29 gebildet. An diese Linsengruppe schließt sich eine vierte Linsengruppe LG3 an, die eine langgestreckte röhrenförmige Gestalt aufweist. In dieser vierten Linsengruppe ist eine Systemblende 19 angeordnet. Diese Linsengruppe LG3 weist auf der der dritten Linsengruppe LG2 zugewandten Seite eine Untergruppe UG3a auf, die geringe positive Brechkraft aufweist. Darauf folgt eine schwach ausgebildete Taille UG3b, die durch zwei negative Linsen gebildet wird, die einen großen Durchmesser, mindestens 85 % des maximalen Durchmesser, aufweisen. Durch diese beiden aufeinanderfolgenden negativ Linsen wird eine schwache Taille UG3b gebildet. Diese Negativlinsen sind Teil der Dubletts D1 und D2. Weiterhin sind noch zwei weitere Dubletts, mit D3 und D4 bezeichnet, vor der Systemblende 19 angeordnet. Mit D5 ist ein weiteres Dublett

bezeichnet, dass eine Doppelsphäre durch die Asphären auf den Linsenoberflächen 46 und 47 aufweist. Der Endbereich mit UG3d bezeichnet, umfasst eine Mehrzahl von dünnen Linsen, durch die das aufgeweitete Lichtbündel 23 auf den Wafer bzw. auf die Bildebene fokussiert wird.

Die in Figur 3 gezeigte Linsenanordnung 21 ist ebenfalls für die Wellenlänge 193 nm ausgelegt und weist eine Baulänge von 1344 mm auf. Das mit dieser Linsenanordnung 21 belichtbare Feld beträgt 10,5x26 mm². Die numerische Apertur beträgt 0,85. Mit diesem Objektiv wird das Objekt 9 um den Faktor 4 verkleinert auf die Bildebene 13 abgebildet. Die genauen Linsendaten sind der Tabelle 2 zu entnehmen.

TABELLE 2

M1	534a			DDECTE	ATT 1/0 EDITION
FL.	RADIEN	DICKEN	GLAESER	BRECHZA 193.304mm	AHL 1/2 FREIER DURCHMESSER
0	0.000000000	24.172413800	N2	1.00000320	56.080
1	0.000000000	15.006569837	N2	1.00000320	61.282
2	599.473674706AS	17.471359581	SIO2HL	1.56028895	65.688
3	142.945533106	15.594383723	N2	1.00000320	67.351
4	520.792476125AS	15.866311924	SIO2HL	1.56028895	70.201
5	458.213670894	35.531230748	N2	1.00000320	72.731
.6	-130.942246277	29.261434955	SIO2HL	1.56028895	75.090
7	-522.434408367	1.046065674	N2	1.00000320	96.747
8	-6686.031621900	34.314309045	SIO2HL		
9	-218.186494807	0.676827586	N2	1.00000320	106.388
10	706.363261168	45.122462397	SIO2HL		
11	-278.472163674	0.676827586	N2	1.00000320	120.155
12	959.514633579	36.082624687	SIO2HL	1.56028895	118.383
13	-896.787607317	4.587825747	N2	1.00000320	116.762
14	158.750812726	85.801121037	SIO2HL		
15	300.475102689AS	43.038670535	N2	1.00000320	83.117
16	-175.884377464A	6.768275864	SIO2HL		72.476
17	320.319576676	27.446116916	N2	1.00000320	68.293
18	-146.443321423	9.668965520	SIO2HL		
19	339.454879151	28.665475857	N2	1.00000320	72.279
20	-161.977156970	10.635862072	SIO2HL		
21	-238.647909042AS		N2	1.00000320	79.551
22	-150.311235300	27.766876031	SIO2HL		
23	-155.362800581	0.676827586	N2	1.00000320	92.928
24	-428.765583246	34.936111184	SIO2HL		
25	-220.472579824	0.676827586	N2	1.00000320	108.198
26	-438.752339375	25.651183289	SIO2HL		111.993
27	-486.537649387	16.665277911	N2	1.00000320	118.679
28	286.503340486	84.567562777	SIO2HL		
29	-370.847311034	7.492580442			135.394
30	-366.945132944AS		SIO2HL	1.56028895	132.013
31		32.431277232			128.108
32		11.602758624	SIO2HL	1.56028895	128.110
33	537.388094819	2.743298664	N2 1	1.00000320 1	131.720
				4.4	•

34	408.077824696	42.484571757	SIO2HL 1.56028895 134.394
35	-717.357209302	0.676827586	N2 1.00000320 134.718
36	583.086197224A	LS 6.768275864	SIO2HL 1.56028895 133.965
37	269.271701042	7.352686536	N2 1.00000320 133.550
38	281.248185100	35.203322187	SIO2HL 1.56028895 136.018
39	472.606393970	3.186212988	N2 1.00000320 135.918
40	363.576248488	54.546183651	SIO2HL 1.56028895 137.633
41	-468.746315410	23.108875520	N2 1.00000320 137.324
42	-251.383937308	11.602758624	SIO2HL 1.56028895 136.437
43	-1073.133309030	33.841379320	N2 1.00000320 140.158
44	0.000000000	-24.172413800	N2 1.00000320 142.969
45	300.919916537	63.201252893	SIO2HL 1.56028895 150.411
46	-982.360166014 <i>A</i>	S11.220067842	N2 1.00000320 149.618
47	-644.040642268	LS11.602758624	SIO2HL 1.56028895 148.330
48	251.499390884	13.548863209	N2 1.00000320 144.384
49	295.116548681	83.834389825	SIO2HL 1.56028895 147.231
50	-592.936469041	0.676827586	N2 1.00000320 147.243
51	463.737108447	36.976613477	SIO2HL 1.56028895 141.167
52	-1426.895647680	0,695672042	N2 1.00000320 139.475
53	140.559527472	39.416922789	SIO2HL 1.56028895 113.157
54	220.743893827	0.878083956	N2 1.00000320 106.607
55	135.149194981	30.341942424	SIO2HL 1.56028895 96.272
56	227.528619088	0.689419669	N2 1.00000320 89.300
57	157.276474717	26.304510971	SIO2HL 1.56028895 82.536
58	236.864111032	8.994847659	N2 1.00000320 70.218
59	366.476934349	10.551547532	SIO2HL 1.56028895 63.779
60	98.334230915	0.676870172	N2 1.00000320 49.220
61	98.324175829	8.007759247	SIO2HL 1.56028895 48.802
62	76.949074769	8.603791096	N2 1.00000320 42.525
63	99.077661785	24.844220969	SIO2HL 1.56028895 39.131
64	511.945903814	8.702068968	N2 1.00000320 26.963
65	0.000000000	0.000000000	N2 · 1.00000320 14.020
66	0.000000000	0.000000000	1.00000000 14.020

ASPHAERISCHE KONSTANTEN

FLAECHE NR. 2

- C0 0.0000
- C1 1.28169760e-007
- C2 -7.84396436e-012
- C3 4.40001122e-016
- C4 -7.79882973e-021
- C5 -1.30623440e-023
- C6 2.14846923e-027
- C7 -1.41595024e-031
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

- C0 0.0000
- C1 8.23267830e-008
- C2 2.76986901e-012
- C3 -1.95568740e-016
- C4 -7.24098423e-021
- C5 1.06376091e-023
- C6 -1.43486056e-027

- C7 1.06511374e-031
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 15

- CO 0.0000
- C1 -7.43129292e-009
- C2 -2.93262230e-012
- C3 -2.03722650e-016
- C4 -1.22563860e-020
- C5 · 5.96520089e-025
- C6 -1.46602552e-028
- C7 1.53867443e-032
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 16

- CO 0.0000
- C1 -3.79251645e-008
- C2 3.22483445e-012
- C3 1.95986817e-016
- C4 2.59408631e-020
- C5 -1.79899203e-024
- C6 -1.09069425e-029
- C7 3.19439367e-033
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 21

- CO 0.0000
- C1 -1.34732963e-008
- C2 2.75857068e-012
- C3 1.90481938e-016
- C4 2.08472207e-020 C5 -6.19866674e-025
- C5 -6.19866674e-025 C6 2.52896158e-028
- C7 -1.80211827e-032
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 30

- CO 0.0000
- C1 -2.23816289e-009
- C2 6.79079206e-013
- C3 -2.77226923e-018
- C4 -1.25547219e-022
- C5 -1.58964362e-026
- C6 6.91621100e-031
- C7 -9.74826154e-036
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

- CO 0.0000
- C1 -1.48722851e-008
- C2 -3.21783489e-013
- C3 -1.94353769e-018
- C4 -1.66369859e-022
- C5 8.53060454e-028
- C6 -4.40031159e-032
- C7 -1.13839635e-036
- C8 0.00000000e+000 C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 46

- CO 0.0000
- C1 -1.29322449e-009
- C2 -7.13114740e-014
- C3 -9.86341305e-018
- C4 7.04573131e-023
- C5 6.79406884e-027
- C6 -5.13273315e-031
- C7 8.48667932e-036
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 47

- CO 0.0000
- C1 -6.45902286e-009
- C2 -2.38977080e-014
- C3 -1.08609626e-017
- C4 2.89713800e-023
- C5 1.03658811e-026
- C6 -6.18950334e-031
- C7 1.10366044e-035 C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

Die in Figur 4 dargestellte Linsenanordnung ist für die Belichtungswellenlänge 157 nm ausgelegt. Die Baulänge beträgt 1390,0 mm gemessen von Objektebene 0 zu Bildebene 0'. Mit dieser Linsenanordnung 21ist ein Feld von 10,5 mmx26mm belichtbar. Der makroskopische Aufbau dieser Linsenanordnung unterscheidet sich nur unwesentlich von dem in Figur 3 dargestellten Linsenanordnung, so dass hier auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet wird. Die genauen Linsendaten sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

TABELLE 3

M1640a

TATT	0-10a			BRECHZAHL	1/2 FREIER
FL.	RADIEN	DICKEN	GLAESER		DURCHMESSER
0	0.000000000	25.000000000	N2V157	1.0003142	29 59.000
1	0.000000000			•	
2		8AS 18.72451			
3	48.181482862				
4	564 22613714	4AS 16.592649			
5	465.19718824				
6	-136.83695487				5 78.647
7	-551.74595164				101.430
8	-9088.9715631			V157 1.559290	35 108.594
9	-226.95682333			7 1.00031429	111.475
10	723.6790039			/157 1.559290	35 125.059
11	-289.6142385			7 1.00031429	126.015
12	910,1535813			/157 -1.559290	35 124.006
13	-966.4606842		099 N2V15	7 1.00031429	
14	165.1678130		493 CAF2\	/157 1.559290	35 110.777
15		61AS 44.56075	55800 N2V	157 1.000314	29 86.752
16		49AS 7.00000		2V157 1.55929	
17	324.2464385				
18	-151.8257749	85 10.000000	0000 CAF2		
19	355.9466942	53 29.718149	685 N2V15		
20	-167.0342954				
21	-246.2250689	97AS 15.9008	79213 N2V		
22	-155.0887996	72 28.774591			
23	-160.0650897				
24	-441.8110527				
25	-228.5220636				
26	-454.1363977				
27	-500.1195003				
28	296.7135518				
29	-382.3141230				
30		15AS 12.0000		2V157 1.5592	
31	607.2160674				
32	-570.1640446				
33	564.5333735				
34					
35					
36		89AS 7.00000			
37	279.9085463			V157 1.559290	
38	292.0676259				
39					
40					
41					
42 43					
44		00 -25.000000			
45					•
45		350AS 11.481		V157 1.00031	
47		992AS 12.0000		2V157 1.5592	
48					
49					
50					
	02.1.0000			16	

51	476.256251891	38.263167655	CAF2V157 1.55929035 148.491
52	-1486.494799770	0.719489630	N2V157 1.00031429 147.010
53	145.476122811	40.782858325	CAF2V157 1.55929035 119.019
54	229.665054801	0.933275871	N2V157 1.00031429 113.051
55	140.220419138	31.392645646	CAF2V157 1.55929035 101.740
56	234.824506571	0.723640009	N2V157 1.00031429 95.088
57	162.332837065	27.214899096	CAF2V157 1.55929035 87.541
58	244.278333665	9.299918126	N2V157 1.00031429 74.726
59	376.868342950	10.929551626	CAF2V157 1.55929035 67.902
60	101.455739030	0.715773254	N2V157 1.00031429 51.847
61	101.162965635	8.299519050	CAF2V157 1.55929035 51.361
62	79.437870675	8.884307252	N2V157 1.00031429 44.619
63	102.534993850	25.750482491	CAF2V157 1.55929035 41.066
64	527.160854703	9.000000000	N2V157 1.00031429 28.053
65	0.000000000	0.000000000	N2V157 1.00031429 14.750
66	0.000000000	0.000000000	1.00000000 14.750

ASPHAERISCHE KONSTANTEN

FLAECHE NR. 2

- C0 0.0000
- C1 1.13998854e-007
- C2 -6.36178693e-012
- C3 3.23659752e-016
- C4 -5.32444727e-021
- C5 -8.32495109e-024
- C6 1.27324768e-027
- C7 -7.83910573e-032
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 4

- C0 0.0000
- C1 7.54224753e-008
- C2 2.18650725e-012
- C3 -1.43119795e-016
- C4 -4.77106422e-021 C5 6.81749068e-024
- C6 -8.54589429e-028
- C7 5.97164385e-032
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

- C0 0.0000
- C1 -6.96085201e-009
- C2 -2.46245992e-012
- C3 -1.57870389e-016
- C4 -8.75762750e-021
- C5 3.86817665e-025
- C6 -9.00885871e-029
- C7 8.78630596e-033
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 16

- C0 0.0000
- C1 -3.45865856e-008
- C2 2.71322951e-012
- C3 1.50235080e-016
- C4 1.89751309e-020
- C5 -1.30006219e-024
- C6 6.16358831e-030 C7 1.17159428e-033
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 21

- C0 0.0000
- C1 -1.29712266e-008
- C2 2.27339781e-012
- C3 1.44782825e-016
- C4 1.49868277e-020
- C5 -4.08871955e-025
- C6 1.55577307e-028
- C7 -1.00785028e-032
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 30

- C0 0.0000
- C1 -2.06288424e-009
- C2 5.71589058e-013
- C3 -2.21154944e-018
- C4 -8.89810821e-023
- C5 -1.08068385e-026
- C6 4.36847400e-031
- C7 -5.73712694e-036
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 36

- C0 0.0000
- C1 -1.34482120e-008
- C2 -2.70871166e-013
- C3 -1.46625867e-018
- C4 -1.23067852e-022
- C5 6.79261614e-028
- C6 -3.16281062e-032
- C7 -5.79252063e-037
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

- C0 0.0000
- C1 -1.19258053e-009
- C2 -6.06323614e-014
- C3 -7.79480128e-018

- C4 5:18508440e-023
- C5 4.67224846e-027
- C6 -3.31365069e-031
- C7 5.12625482e-036
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 47

- CO 0.0000
- C1 -5.81614530e-009
- C2 -2.06494325e-014
- C3 -8.58899622e-018
- C4 2.06606063e-023
- C5 7.14078196e-027
- C6 -3.99032238e-031
- C7 6.64567245e-036
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

Die in Figur 5 dargestellt Linsenanordnung 21 ist ebenfalls für die Wellenlänge 157,6 nm ausgelegt. Dieses Linsenanordnung 21 unterscheidet sich maßgeblich dadurch, dass nur 3 Dubletts D1, D2 und D4 vor der Systemblende 19 angeordnet sind. Das in den vorhergehenden Figuren mit D3 zeichnete Dublett ist entfallen. Die beiden aufeinanderfolgenden Negativlinsen, durch die die zweite schwach ausgeprägte Taille gebildet wird, sind beabstandet voneinander angeordnet. Durch diese geänderte Anordnung und die Einsparung des Dublets D3 wird erreicht, dass das Linsenvolumen sinkt.

Die genauen Linsendaten sind der nachfolgenden Tabelle 4 zu entnehmen.

Tabelle 4

m1641a

pat_m1641a.txt TABELLE 4

M1641a				•	. .
	•			BRECHZAHL	1/2 FREIER
.FLAECH	e radien	DICKEN	GLAESER	157.629nm	DURCHMESSER
0	0.000000000	23.762838750	N2V157.	1.00031429	56.080
· ĭ	0.00000000	14.246137526	N2V157	1.00031429	61.246
2	514.707276562AS	13.981815236	CAF2V157	1.55929035	65.688
3 ·	138.212721202	15.579876293	N2V157	1.00031429	66,951
4	534.824781243AS	12.739496641	CAF2V157	r.55929035	69.622
5	389.864179126	33.913726677	N2V157	1.00031429	71.684
6	-131.473719619	28.107831970	CAF2V157 .	1.55929035	73.586
7	-471.981433,648	1.069906657	N2V157	1.00031429	93.899
8	0.000000000	34.308184523	CAF2V157	1.55929035	101.225
9	-228.280123150	0.704684075	N2V157	. 1.00031429	104.724
10	796,724829345	43.758159816	CAF2V157	1.55929035	116.173 117.347
11	-266.360318650	0.745094303	N2V157	1.00031429	117.347
12	1081.261439844	23.811542913	CAF2V157 N2V157	1.55929035 1.00031429	115:443
13	-712.390784368	9.916731254 80.929657183	CAF2V157	1.55929035	103.893
14 15	158.258040233 328.916333526AS	43.637981348	N2V157	1.00031429	83.021
16	-163.783184213AS		CAF2V157	1.55929035	71.477
17	294.432712383	27.405950067	N2V157	1.00031429	67.256
18	-144.330554051	8.234758928	CAF2V157	. 1.55929035	67.032
19	397.835892386	28.266532844	N2V157	1.00031429	71.373
20	-161.553948900	10.395325272	CAF2V157	1.55929035	72.890
21	-258.614401773AS	15.068965479	` N2V157	1.00031429	79.201
22	-148.191144865	27.281969779	CAF2V157	1.55929035	80.726
23	-153.092043553	0.711404699	N2V157	1.00031429	91.935
24	-429.848987135	34.313214826	CAF2V157	1.55929035	100.580
25	-222.509319222	0.755186371	N2V157	1.00031429	107.422
26	-446.042338354	25.134410060	CAF2V157	. 1.55929035	111.325
27	-476.016743713	16.168036298	N2V157 ·	1.00031429	117.862
28	290.945720195	91.150270987	CAF2V157	1.55929035.	135.561
29 30	-352,999009021 .	7.239891532 10.794904282	N2V157 CAF2V157	1.00031429 1.55929035	134.606 131.837
31	-333.990335846AS 686.418617658	67.606049576	N2V157	1.00031429	128.953
32 ·	484.704981071AS	20.247999550	CAF2V157	1.55929035	129.812
33 .	272.256910986	8.301324639	N2V157	1.00031429	129.690
34	283.424612963	21.444612905	CAF2V157	1.55929035	132.593
35	441.096441131	7.286378331	N2V157	1.00031429	132.611
36	341.080821148	56.120769051	CAF2V157	1.55929035	135.413
37	-467.022730717	23.483002796	N2V157	1.00031429	135.092
38	-251.271987182	10.033317804	CAF2V157	1.55929035	133.934
39	-1127.860216547	34.039044392	N2V157	1.00031429	137.435
40	0.00000000	-23.762838750	N2V157	1.00031429	140.287
41	297.718439650	63.279096400	CAF2V157	1.55929035	148.476
42	-917.492707769AS	10.913617063	N2V157 CAF2V157	1.00031429 1.55929035	147.745 146.599
43	-614.308568323AS	11.278985347 14.012163218	N2V157	1.00031429	143.454
44 45	248.499662987 293.420324051	77.421679876	CAF2V157	1.55929035	146.721
46	-577.615924152	0.827697085	N2V157	1.00031429	146.976
47	428.803478030	38.627735627	CAF2V157	1.55929035	141.309
48	-1538.689777020	0.709093944	N2V157 .	1.00031429	139.590
49	138.430254604	39.259717130	CAF2V157	1.55929035	113.344
50 .	220.629434605	0.852226738	N2V157	1:00031429	107.642
51	134.960023432.	29.998458517	CAF2V157 ·	1.55929035 ·	97.026
52	215.500125113	0.702119104	N2V157	1.00031429	89.828
53	149.475551465	25.893987130	CAF2V157	1.55929035	82.702
54	231.671140781	8.808791935	N2V157	1.00031429	71.084
55	350.283305716	10.400580673	CAF2V157	1.55929035	64.558.
56	145.109553410	0:700000000	N2V157	1.00031429	52.531
· 57	141.455177019	8.001279379	. CAF2V157	1.55929035.	51.711
58	73.955966022	8.329441414	N2V157	1.00031429	42.090
59	96.168359436	24.494556608	CAF2V157	1.55929035	38.879 36.571
60 61	459.800275735	8.554621950	N2V157 N2V157	1.00031429	26.571 14.020
ΩŢ	0.00000000		NSAT21		74.050

pat_m1641a.txt

ASPHAERISCHE KONSTANTEN

```
FLAECHE NR. 2

K 0.0000
C1 1.40076890e-007
C2 -9.37770559e-012
C3 5.50812946e-016
C4 6.20589318e-021
C5 -2.37140019e-023
C6 3.95180787e-027
C7 -2.60792832e-031
C8 0.00000000e+000
```

0.00000000e+000

FLAECHE NR. 4 .

C9

```
    K
    0.0000

    C1
    9.46620092e-008

    C2
    3.31455802e-012

    C3
    -2.39290707e-016

    C4
    -1.71234783e-020

    C5
    1.74026756e-023

    C6
    -2.43020107e-027

    C7
    1.77431459e-031

    C8
    0.00000000e+000

    C9
    0.00000000e+000
```

FLAECHE NR. 15

K	D.0000 .
C1	-1.23543806e-008
C2	-3.08782621e-012
C3	-2.03630284e-016
C4	-8.16153110e-021
C5	.1.74407091e-025
C6	-5.09307070e-029
C7	1.00885745e-032
CB	D.00000000e+000
C9	0.00000000e+000

FLAECHE NR. 16

K	0.0000
Cl	-4:62416977e-008
C2	5.09342413e-012
C3	1.93873885e-016
C4	2.75889868e-020
C5	-1.64807233e-024
C6	-1.89286552e-028
C7	1.58124115e-032
C8	0.00000000e+000
C9	0.00000000e+000

FLAECHE NR. 21

K	0.0000
C1	-2.13181934e-008
C2	3.39572804e-012
C3	1.70428863e-016
C4	2.27977453e-020
C5	-9.47218587e-025
C6	2.65529506e-028
C7	-2.14888777e-032
CB	0.00000000e+000
C9	0.00000000e+000

pat_m1641a.txt

```
K 0.0000
C1 -2.44196650e-009
C2 6.83785083e-013
C3 -4.77483094e-018
C4 -4.35836087e-023
C5 -1.74046992e-026
C6 6.83065300e-031
C7 -9.01251572e-036
C8 0.00000000e+000
C9 0.00000000e+000
```

FLAECHE NR. 32

K	0.0000
.C1	-1.53715814e-008
C2	-3.53812954e-Q13
C3	-8.52862214e-019
C4	-2.84552357e-022
Ç5	3.34667441e-027
C6	-1.70981346e-031
C7	8.06815620e-038
C8-	0.00000000e+000
C9	0.0000000e+000

FLAECHE NR. 42

K	0.0000
C1	-1.38703825e-009
C2	-7.42014625e-014
C3	-1.11669633e-017
C4	7.72614773e-023
C5·	8.16034068e-027
C6	-6.36127613e-031
C7	1.09104108e-035
C8	0.00000000e+000
C9	0.00000000e+000

K	0.0000
C3	-6.81804423e-009
C2	-3.12076075e-014
C3	-1.22481799e-017
C4	2.99026626e-023
C5	1.23468742e-026
C6	-7.60144642e-031
C7	1.42018134e-035
C8	0.00000000e+000
C9	0.00000000e+000

Die in Figur 6 dargestellte Linsenanordnung 21ist für die Wellenlänge 193 Nanometer ausgelegt. Das belichtbare Feld beträgt 10,5 mm x 26 mm. Die Baulänge von Objektebene 0'- Bildebene 0' beträgt 1200 mm. Die für die Herstellung erforderliche Materialmenge an Quarzglas beträgt lediglich 103 kg. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel, genauso wie dem in Figur 5 gezeigten Ausführungsbeispiel, sind insgesamt nur 4 Dubletts vorgesehen. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist auf das Dublett, dass in den Figuren 2-4 mit D3 bezeichnet worden ist, entfallen. Die genauen Linsendaten sind der nachfolgenden Tabelle 5 zu entnehmen.

Tabelle 5 M1656a

				BRECHZAHL	1/2 FREIER FLAECHE
Fl.	RADIEN	DICKEN	GLAESE	R 193.304 nm	DURCHMESSER
	,				
0	0.000000000	22.812325200	N2	1.00000320	56.080
1	0.000000000	10.339145912	N2 :	1.00000320	61.040
2	1344.886802290	AS 15.88197116	9 IO2HL	1.56028895	63.970
3	232.178777938	15.628670502	N2	1.00000320	66.074
4	-537.599235732	AS 10.25125614	4 SIO2HI	1.56028895	67.146
5	357.600737011	39.221339825	N2	1.00000320	71.765
6	-107.956923549	18.404856395	SIO2HL	1.56028895	73.446
7	-243.717356229	0.700350683	N2	1.00000320	92.692
8	0.000000000	41.961272197	SIO2HL	1.56028895	108.723
9	-202.822623296	0.701099003	N2	1.00000320	112.352
10	908.396780928	46.105755859	SIO2HI	1.56028895	127.495
11	-324.403526021	0.700000000	N2	1.00000320	129.122
12	272.374319621	70.961916034	SIO2HI	1.56028895	129.626
13	-861.339949580	0.801352132	N2	1.00000320	124.293
14	189.599720148	87.814706985	SIO2HI	1.56028895	107.193
15	235.651582170	AS 33.93934801	.0 N2	. 1.00000320	73.553

16	-167.950781585 23.127229402 SIO2HL	1.56028895	71.043
17	418.275060837AS 29.676213557 N2	1.00000320	66.843
18	-122.074492458 12.991654582 SIO2HL	1.56028895	65.012
19	225.914585773 27.597144000 N2	1.00000320	69.278
20	-207.944504375 9.625251661 SIO2HL	1.56028895	70.891
21	-222.237071915AS 12.259114879 N2	1.00000320	74.459
22	-143.306961785 25.742020969 SIO2HL	1.56028895	75.779
23	-171.350364563 0.700000000 N2	1.00000320	87.359
24	-584.950465544 30.430256525 SIO2HL	1.56028895	94.810
25	-322.926323860 0.700000000 N2	1.00000320	102.056
26	-2074.519592980 18.436325366 SIO2HL	1.56028895	106.932
27	-454.899324547 0.700000000 N2	1.00000320	108.765
28	311.973161398 60.379264795 SIO2HL	1.56028895	116.799
29	-244.157709436 4.226375511 N2	1.00000320	116.691
30	-226.802865587AS 8.000000000 SIO2HL	1.56028895	115.226
31	581.003793889AS 33.843695716 N2	1.00000320	113.965
32	433.165006354AS 8.000000000 SIO2HL	1.56028895	117.646
33	220.638014434 6.160147896 N2	1.00000320	117.478
34	235.847612538 38.094085109 SIO2HL	1.56028895	119.548
35	2922.562377140 10.091385703 N2	1.00000320	119.635
36	828.603251335 34.242333007 SIO2HL	1.56028895	120.292
37	-421.523524573 19.499093440 N2	1.00000320	120.075
38	-227.399216829 8.000000000 SIO2HL	1.56028895	119.391
39	-713.133778093 32.677482617 N2	1.00000320	122.273
40	0.000000000 -22.812325200 N2	1.00000320	124.721
41	477.077275979 54.887245264 SIO2HL	1.56028895	128.109
42	-302.959408554AS 9.015123458 N2	1.00000320	128.235
43	-259.248633314AS 8.000000000 SIO2HL	1.56028895	127.331
44	257.367927097 9.018964995 N2	1.00000320	132.095
45	301.442153248 62.427272391 SIO2HL	1.56028895	134.626
46	-415.709868667 0.700000000 N2	1.00000320	135.476
47	247.440229366AS 47.657128386 SIO2HL	1.56028895	133.887

48	-288949.445195000	0.700000000	N2	1.00000320	131.978
49	151.825283163	37.348129556	SIO2HL	1.56028895	112.363
50	293.987758399	0.700000000	N2 .	1.00000320	107.532
51	140.326981621	28.581518950	SIO2HL	1.56028895	94.765
52	219.719357959	0.700000000	N2	1.00000320	86.981
53	142.826791834	24.808199570	SIO2HL	1.56028895	79.406
54	283.110177788	7.914740800	N2	1.00000320	70.515
55	510.756323891	9.591341155	SIO2HL	1.56028895	64.645
56	266.825722219	0.722333492	N2	1.00000320	55.512
57	215.942664188	8.000000000	SIO2HL	1.56028895	53.165
58	72.787640467	7.718712927	N2	1.00000320	41.272
59	93.765259707	24.684737028	SIO2HL	1.56028895	38.377
60	469.355888001	8.212437072	N2 .	1.00000320	26.099
61	0.000000000	0.000000000	N2	1.00000320	14.020
62	0.000000000	0.000000000	1.00	0000000 14.0	020

ASPHAERISCHE KONSTANTEN

FLAECHE NR. 2

- C0 0.0000
- C1 1.52757338e-007
- C2 -1.39394902e-011
- C3 7.41376692e-016
- C4 -3.46945761e-019
- C5 8.95992656e-023
- C6 -1.64136955e-026
- C7 1.18641735e-030
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

- CO 0.0000
- C1 4.00562871e-008
- C2 4.60196624e-012
- C3 -3.47640954e-016
- C4 1.69507580e-019
- C5 -3.89922208e-023
- C6 7.79027536e-027
- C7 -5.53241761e-031
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 15

- C0 0.0000
- C1 5.47524591e-008
- C2 5.05793043e-013
- C3 3.05008775e-017
- C4 -1.98253574e-021
- C5 7.84443491e-025
- C6 -1.27239733e-028
- C7 6.73733553e-033
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

- CO 0.0000
- C1 -9.99718876e-008
- C2 -8.52059462e-012
- C3 -5.86845398e-016
- C4 -6.64124324e-020

- C5 -4.60657771e-024
- C6 -5.51712065e-028
- C7 0.00000000e+000
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 21

- C0 0.0000
- C1 -1.77390890e-008
- C2 1.86160395e-012
- C3 2.57697930e-016
- C4 2.73779514e-020
- C5 4.36917581e-024
- C6 -1.21030389e-028
- C7 7.05508252e-032
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000 ·

- C0 0.0000
- C1 -2.92222111e-009
- C2 6.98720386e-013
- C3 9.60282132e-018
- C4 4.51192034e-022
- C5 -8.63764902e-026
- C6 2.79307913e-030
- C7 -4.28143587e-035
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 31

- CO 0.0000
- C1 3.79088573e-009
- C2 1.54225743e-013
- C3 2.58122902e-018
- C4 7.06529922e-022
- C5 -4.65550297e-026
- €6 1.02837481e-030
- C7 2.54076903e-036
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHENR. 32

- C0 0.0000
- C1 -1.43835369e-008
- C2 9.53138635e-014
- C3 -7.72742465e-019
- C4 -5.55446815e-023
- C5 1.85136302e-026
- C6 -1.44110574e-030
- C7 3.72591227e-035
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

- C0 0.0000
- C1 -1.46322720e-009
- C2 -7.32982723e-014

- C3 -4.12559846e-018
- C4 1.10568402e-022
- C5 8.54286956e-027
- C6 -8.34588063e-031
- C7 1.97309537e-035
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

FLAECHE NR. 43

- C0 0.0000
- C1 -6.88182408e-009
- C2 1.49845458e-014
- C3 -3.68264031e-018
- C4 1.78132275e-022
- C5 6.62312346e-027
- C6 -8.68541514e-031
- C7 2.32817966e-035
- C8 0.00000000e+000
- C9 0.00000000e+000

- C0 0.0000
- C1 1.62217387e-009
- C2 -6.74169300e-014
- C3 1.20108340e-018
- C4 1.21664354e-023
- C5 -1.11444071e-027
- C6 1.08479154e-031
- C7 -2.93513997e-036
- C8 0.00000000e+000

C9 0.000000000e+000

Die asphärischen Linsenoberflächen werden durch die Gleichung:

$$P(h) = \frac{h^2 / R}{1 + \sqrt{1 - (1 + C_0)h^2 / R^2}} + C_1 h^4 + C_2 h^6 + \dots$$

beschrieben, wobei P(h) die Pfeilhöhe als Funktion des Radius h, also der Abstand von einer ebenen Fläche ist, die durch den Flächenscheitel geht und senkrecht zur optischen Achse orientiert ist. C_1 bis C_n sind die in den Tabellen angegebenen asphärischen Konstanten und C0 ist die konische Konstante. R ist der in den Tabellen angegebene Scheitelradius.

Bei der Frage nach dem für die Belichtung im Resist noch erträglichen Kontrastabfall, zeigt sich, dass der Kontrastabfall durch den Farblängsfehler eines Lithographieobjektives deutlich beeinflusst wird. Um die Bandbreite eines Systems über verschiedene Aperturen, Wellenlängen, Materialien und Strukturbreiten zu ermitteln, werden folgende maximale Zerstreuungskreise, die durch den Farblängsfehler induziert werden, vorgeschlagen:

Durchmesser des Zerstreuungskreises < 2,2 x Strukturbreite und vorzugsweise

Durchmesser des Zerstreuungskreises < 2,0 x Strukturbreite

Der chromatisch induzierte Zerstreuungskreis soll bei maximaler Apertur und bei einem $\Delta\lambda$ von der Hälfte der Lichtquellenbandbreite zur mittleren Arbeitswellenlänge ermittelt werden.

In der nachfolgenden Tabelle wurde die Bandbreite eines Systems für folgendes Verhältnis ermittelt:

Durchmesser des Chromatischen Zerstreuungskreises = 2,1 * Strukturbreite, dies ergibt einen Kontrastabfall von etwa 6,5% des polychromatischen Systems zum monochromatischen System für Gitterstrukturen.

Bez.	λin nm	NA	Bildfeld mm²	Struktur- breite in mm K ₁ =0,32	Band- breite pm	Material	CHL mm/pm	Asph. Zahl	KCHL
1471a	193	0,8	26x10,5	77,3	0,31	SiO	392	9	5,02
1634a	193	0,85	26x10,5	72,8	0,24	SiO ₂	401	9	5,13
1656a	193	0,85	26x10,5	72,8	0,26	SiO ₂	367	11	4,71
1640a	157	0,85	26x14	59,3	0,12	CaF ₂	672	9	5,18
1641a	157	0,85	26x10,5	59,3	0,12	CaF ₂	668	9 .	5,15
m1450a	193	0,85	26x8	72,8	0,19	SiO ₂	503	11	6,64
m1159a	248	0,83	26x8	95,8	0,75	SiO ₂	180	4	6,07

Die Strukturbreite wurde nach der folgenden Formel bestimmt:

Strukturbreite =
$$\frac{\lambda * K_1}{NA}$$
.

Dabei wurde ein K₁ von 0,32 gewählt. Der K₁ Wert variiert sinnvoller Weise zwischen 0,27 und 0,35. Die Kennziffer KCHL kann den Vergleich zwischen unterschiedlichen refraktiven Lithographiedesigns herstellen bezüglich der Erzeugung des chromatischen Längsfehlers unter den Bedingungen Bildfeld, Bandbreite der Lichtquelle und Materialdispersion der verwendeten Linsen. Besteht das Objektiv nur aus einem Material wird nur diese eine Materialdispersion benutzt. Besteht das Objektiv aus mehreren Materialien erhält jede Linse ein synthetisches Ersatzmaterial mit einer Brechzahl wie bisher, aber einer einheitlichen wählbaren Dispersion zur Errechnung des Ersatz CHL.

$$KCHL = \frac{CHL[nm]}{\Delta \lambda [nm]^* (\frac{\Delta n}{n-1})^* y \max[nm]}$$

CHL ist der chromatische Längsfehler

Δλ ist das Bandbreitenintervall

Y'max ist der maximale Bildfelddurchmesser.

Vorteilhafterweise gibt man die numerischen Werte für CHL, Δλ und Y max alle in nm ein, für Δλ wählt man beispielsweise einen Wert von 1nm. Um den Stand der Technik zu dokumentieren wurden aus der WO 01/50171 Al die Beispiel m 1159a repräsentiert einen ganz typischen KCHL Wert von 6,07 der nur in ganz engen Grenzen von allen refraktiven Lithographieobjektiven variiert. Ein so hoher KCHL Wert von 6,64 für das Bespiel mit Bezeichnung m 1450a ist als Ausnahme nach oben gezeigt.

Werte deutlich unter 6,0 werden erstmalig mit den in hier gezeigten Ausführungsbeispielen erreicht. Insbesondere im Beispiel m 1656a wurde ein extrem kleiner KCHL bewiesen. (KCHL = 4,71) Dieser ermöglicht es erstmalig für 193 nm und etwa 70nm Strukturbreite nur SiO2 als Linsenmaterial einzusetzen. Der völlige Verzicht auf CaF₂ bei 70nm Strukturen und das Reduzieren des CaF₂ Volumen für noch kleinere Strukturen ist enormer wirtschaftlicher Vorteil. Die Objektiv hier gezeigter Bauart besitzen:

Einen KCHL Wert von < 5,3 vorzugsweise

einen KCHL Wert von < 5,0 und ganz bevorzugt einen

KCHL Wert von < 4,8

Bezugszeichenliste:

- 1 Projektionsbelichtungsanlage
- 3 Beleuchtungseinrichtung
- 5 Projektionsobjektiv
- 7 optische Achse
- 9 Maske
- 11 Maskenhalter
- 13 Bildebene
- 15 Wafer
- 17 Substrathalter
- 19 Systemblende
- 21 Linsenanordnung
- 23 Lichtbündel
- 25 größter Lichtbündeldurchmesser
- 27 Lichtbündeldurchmesser
- 29 erste Taille

WO 03/075097 PCT/EP03/01651

Patentanpsrüche

1. Refraktives Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie mit einer Linsenanordnung bei dem alle Linsen aus einem Material bestehen und das eine bildseitige numerische Apertur (NA) von größer 0,7 aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das die Linsenanordnung (21) transmittierende Lichtbündel (23) im Bereich vor einer in der Linsenanordnung (21) angeordneten Systemblende (19) auf der Länge gleich dem größten Lichtbündeldurchmesser (25) oder des maximalen Linsendurmessers in der Linsenanordnung (21) größer als 85 % des größten Lichtbündeldurchmessers (25) oder des maximalen Linsendurchmessers ist.

2. Refraktives Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie für eine
Belichtungswellenlänge von kleiner 300nm und vorzugsweise einer numerischen Apertur
von mindestens 0,8, dadurch gekennzeichnet, dass alle Linsen aus einem Material
bestehen und der Kennwert KCHL kleiner oder gleich 5,5, vorzugsweise kleiner oder
gleich 5,0 und besonders bevorzugt 4,8 beträgt, wobei für den Kennwert KCHL gilt

$$KCHL = \frac{CHL[nm]}{\Delta \lambda [nm]^* (\frac{\Delta n}{n-1})^* y \max[nm]}$$

CHL ist der chromatische Längsfehler

Δλ ist das Bandbreitenintervall

Y max ist der maximale Bildfelddurchmesser.

- 3. Refraktives Projektionsobjektiv nach Anspruch 1 oder 2, das eine zwischen zwei Bäuchen angeordnete erste Taille aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass nach dieser ersten Taille (29) mindestens 4 Dubletts (D1-D5), bestehend aus einer Negativlinse und einer Positivlinse, angeordnet sind.
- 4. Refraktives Projektionsobjektiv nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche, das eine zweite Taille aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Taille (UG3b)

WO 03/075097 PCT/EP03/01651

durch zwei aufeinanderfolgende Negativlinsen gebildet wird, die zwischen zwei Positivlinsen angeordnet sind, wobei die Positivlinsen jeweils auf der der jeweiligen Negativlinse der Taille (UG3b) zugewandten Seite eine konvexe Linsenoberfläche aufweisen.

- 5. Refraktives Projektionsobjektiv nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass in der zweite Taille (UG3b) der Lichtbündeldurchmesser (23) bzw. der Linsendurchmesser in der zweiten Taille mindestens 85 % des maximalen Linsendurchmessers bzw. Lichtbündeldurchmessers (25) beträgt.
- 6. Refraktives Projektionsobjektiv nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach der ersten Taille (LG2) vier Dupletts (D1, D3, D4, D5) angeordnet sind, die aus einer Positivlinse, auf die direkt eine Negativlinse folgt, bestehen.
- 7. Refraktives Projektionsobjektiv nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen den zueinander gewandten Linsenoberflächen der Dupletts (D1-D5) kleiner als 10 % des gemittelten Linsendurchmessers des jeweiligen Dupletts ist.
- 8. Refraktives Projektionsobjektiv nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zueinander gewandten Linsenoberflächen von mindestens drei Dupletts einen Anstand aufweisen, der kleiner als 10 mm ist.
- Refraktives Projektionsobjektiv nach mindestens einem der vorangegangen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten beiden Linsen der Linsenanordnung (21) negative Brechkraft aufweisen und zum Objekt hin durchgebogen sind.
- 10. Projektionsobjektiv, dass in drei Linsengruppen unterteilbar ist, wobei durch eine erste Linsengruppe, die positive Brechkraft aufweist, ein erster Bauch gebildet wird und durch eine zweite sich anschließende Linsengruppe, die negative Brechkraft aufweist, eine Taille gebildet wird, wobei auf diese zweite Linsengruppe eine lang gestreckte hintere

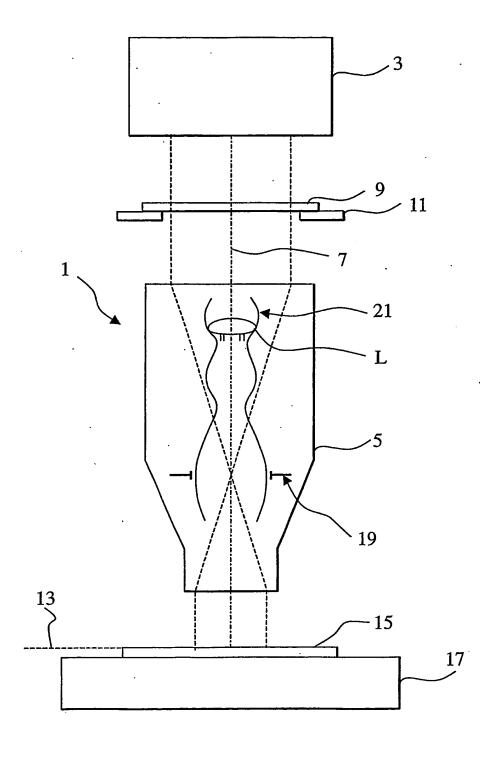
WO 03/075097 PCT/EP03/01651

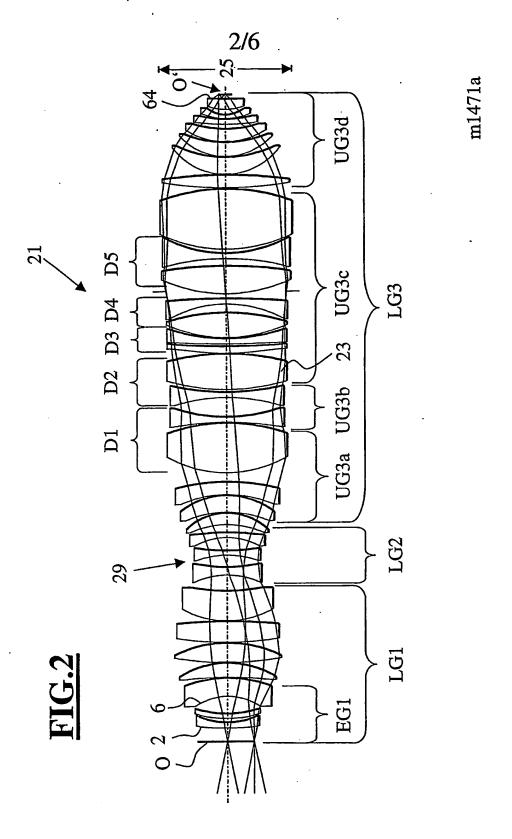
Linsengruppe folgt, in der die Systemblende 19 angeordnet ist und die sich über 60 % der Länge des Projektionsobjektives erstreckt.

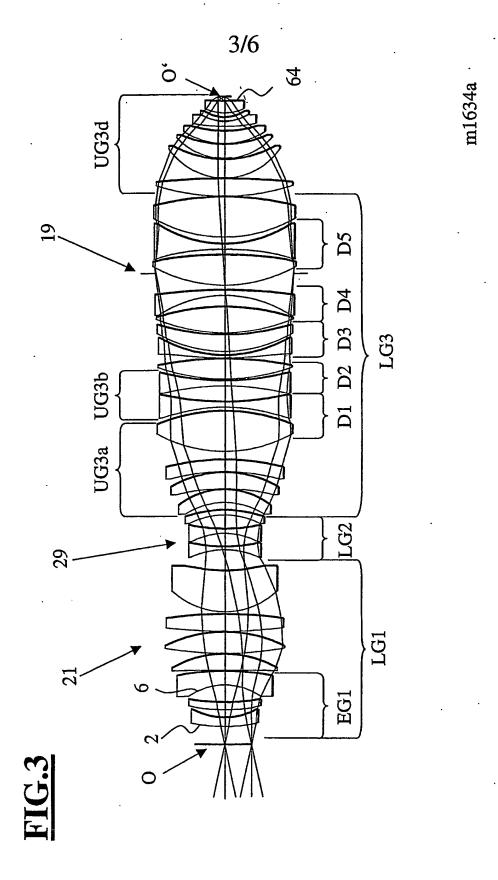
- 11. Refraktives Projektionsobjektiv nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Taille (29) aus drei Negativlinsen besteht.
- 12. Refraktives Projektionsobjektiv nach mindestens einem der vorangegangen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten drei aufeinander folgenden Linsen (EG1) negative Brechkraft aufweisen.
- 13. Projektionsbelichtungsanlage der Mikolithographie, dadurch gekennzeichnet, dass die Projektionsbelichtungsanlage (1) ein Projektionsobjektiv (5) mit einer Linsenanordnung (21) nach mindestens einem der vorangegangen Ansprüche umfaßt.
- 14. Verfahren zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile, bei dem ein mit einer lichtempfindlichen Schicht versehenes Substrat (15) mittels einer Maske (9) und einer Projektionsbelichtungsanlage (1) mit einer Linsenanordnung (21) nach mindestens einem der vorangegangenen Ansprüche durch ultraviolettes Laserlicht belichtet wird und gegebenenfalls nach Entwicklung der Lichtempfindlichen Schicht entsprechend einem auf der Maske (9) enthaltenem Muster strukturiert wird.

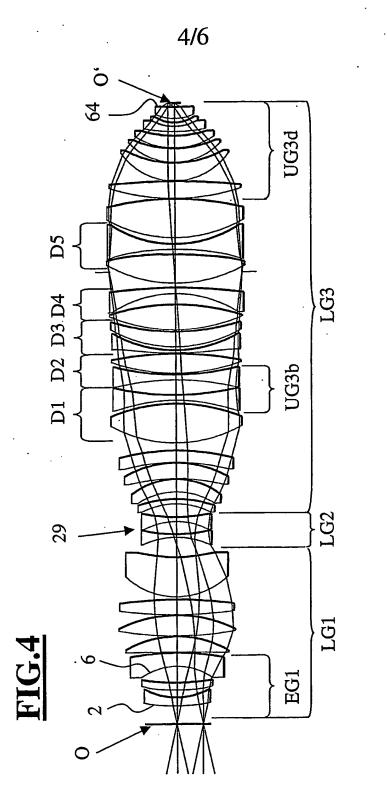
1/6

FIG.1

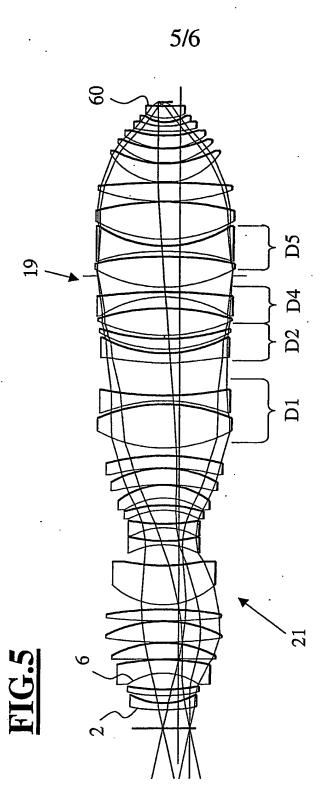




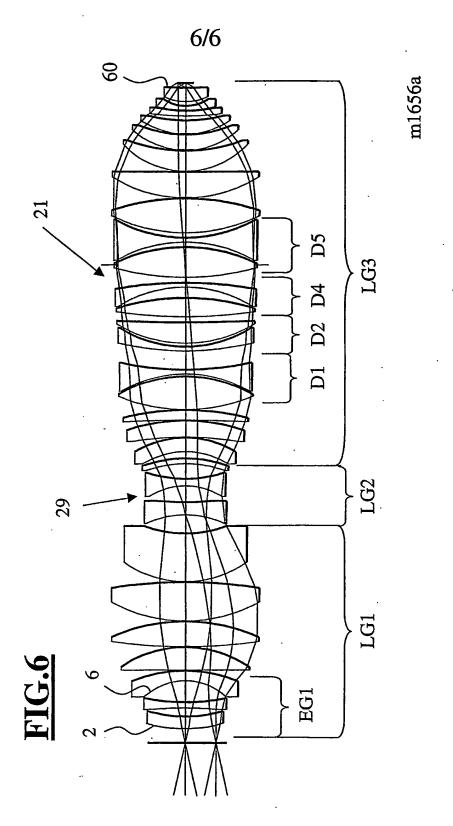




m1640a



m1641a



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. September 2003 (12.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/075097 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP03/01651

G03F 7/20

(22) Internationales Anmeldedatum:

19. Februar 2003 (19.02.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

60/360,845 102 21 243.0 1. März 2002 (01.03.2002) US 13. Mai 2002 (13.05.2002) DE

102 29 249.3

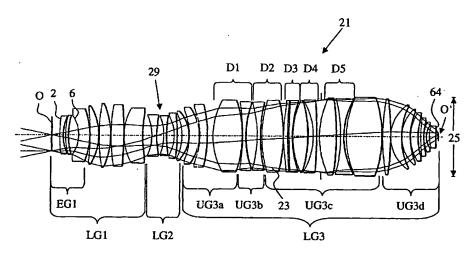
28. Juni 2002 (28.06.2002) I

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CARL ZEISS SMT AG [DE/DE]; Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHUSTER, Karl-Heinz [DE/DE]; Rechbergstrasse 24, 89551 Königsbronn (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: REFRACTIVE PROJECTION LENS WITH A MIDDLE PART
- (54) Bezeichnung: REFRAKTIVES PROJEKTIONSOBJEKTIV MIT EINER TAILLE



(57) Abstract: Disclosed is a refractive projection lens used in microlithography, which comprises a lens array in which all lenses are made of one material, and which has a numerical aperture (NA) of more than 0.7 on the image side. The light beam (23) transmitting through the lens array (21) is greater than 85 percent of the largest diameter (25) of the light beam or the maximum lens diameter in the area located upstream from a system diaphragm (19) which is disposed in the lens array (21) along a distance that is equal to the greatest diameter (25) of the light beam or the maximum lens diameter in the lens array (21).

(57) Zusammenfassung: Refraktives Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie mit einer Linsenanordung bei dem alle Linsen aus einem Material bestehen und das eine bildseitige numerische Apertur (NA) von grösser 0,7 aufweist, wobei das die Linsenanordung (21) transmittierende Lichtbündel (23) im Bereich vor einer in der Linsenanordung (21) angeordneten Systemblende (19) auf der Länge gleich dem grössten Lichtbündeldurchmesser (25) oder des maximalen Lindsendurmessers in der Linsenanordnung (21) grösser als 85% des grössten Lichtbündeldurchmessers (25) oder des maximalen Linsendurchmessers ist.





DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 13. November 2003

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation Polication No PCT/EP 03/01651

A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 7	G03F7/20		
l			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
	ocumentation searched (classification system followed by classification sy	cation symbols)	
IPC 7	G03F		
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent th	at such documents are included. In the fields sea	rched
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, search terms used)	
EPO-In	ternal		
2.0 2			
			····
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
Χ.	DE 198 55 108 A (ZEISS CARL FA) 31 May 2000 (2000-05-31)	1,3,4,	
	31 May 2000 (2000-05-31)	6-8,11, 13,14	
	figures 1-3; tables 1-5		15,14
х	EP 1 111 425 A (ZEISS CARL ;ZEI	1,3,4,	
^	(DE)) 27 June 2001 (2001-06-27)		13,14
	figure 1; table 1		
			•
			j
		1	
		İ	
i			
. Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in a	untex.
* Special cat	egories of cited documents :	*T" later document published after the interna	tional filing date
	nt defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the interna or priority date and not in conflict with the cited to understand the principle or theory	
"E" earter d	ered to be of particular relevance ocument but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the clair	
filing da		cannot be considered novel or cannot be involve an inventive step when the documents	considered to
which is citation	nt which may throw doubts on priority claim(s) or s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claim	ned invention
	nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an inven document is combined with one or more ments, such combination being obvious t	other such doou-
"P" documer	nt published prior to the international filing date but	In the art.	
	an the priority date claimed	"&" document member of the same patent farr	
uate of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international search	report
26	May 2003	0 &	08 03
Name and m	alling address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	•	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3018	Daffner, M	ļ

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. EP03/01651

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	rnational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
	SEE SUPPLEMENTAL SHEET
1:	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. X	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1, 3-9, 11-14
Remark	on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992)

The International Searching Authority has determined that this international application contains more than one invention or group of inventions, namely:

1. claims 1, 3-9 and 11-14

refractive projection lens for microlithography, wherein all lenses are made of one material and the ratio of the diameter of the light beam or lenses in a lens array in front of a diaphragm relative to the maximum diameter of the light beam or lenses is at least 85 % [N.B. Claims 3-9 and 11-14 are considered to belong to this group only insofar as they relate to claim 1];

2. claims 2, 3-9 and 11-14

refractive projection lens for microlithography, wherein all lenses are made of one material and the quotient (KCHL) calculated by dividing the chromatic longitudinal aberration by the bandwidth interval multiplied by the maximum image field diameter is less than a given value [N.B. Claims 3-9 and 11-14 are considered to belong to this group only insofar as they relate to claim 2];

3. claims 10-14

projection lens which can be divided into three lens groups, an elongate rear lens group extending over 60 % of the length of the projection lens [N.B. Claims 11-14 are considered to belong to this group only insofar as they relate to claim 10].

INTERMITIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internation Polication No PCT/EP 03/01651

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19855108	A	31-05-2000	DE WO EP EP JP KR TW US US	19855108 A1 0033138 A1 1006389 A2 1141781 A1 2000171706 A 2002531878 T 2000034926 A 480347 B 6349005 B1 2003007253 A1	31-05-2000 08-06-2000 07-06-2000 10-10-2001 23-06-2000 24-09-2002 26-06-2000 21-03-2002 19-02-2002 09-01-2003
EP 1111425	Α	27-06-2001	EP JP T₩ US US	1111425 A2 2001201682 A 448307 B 2002001141 A1 2001050820 A1	27-06-2001 27-07-2001 01-08-2001 03-01-2002 13-12-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 03/01651

A KLASS IPK 7	ifizierung des anmeldungsgegenstandes G03F7/20		
Nach der in	nternationalen Patentidassiilikation (IPK) oder nach der nationalen Kl	assifikation and der IDV	
	RCHIERTE GEBIETE	assimation trip der [FK	
Recherchie IPK 7	nter Mindestprüfstoff (Massifikationssystem und Massifikationssymi G03F	bola)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	coweit diese unter die recherchierten Gebiete	tallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)
EPO-In	eternal		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 198 55 108 A (ZEISS CARL FA) 31. Mai 2000 (2000-05-31)		1,3,4, 6-8,11, 13,14
	Abbildungen 1-3; Tabellen 1-5	:	·
X	EP 1 111 425 A (ZEISS CARL ;ZEIS (DE)) 27. Juni 2001 (2001-06-27) Abbildung 1; Tabelle 1	S STIFTUNG	1,3,4, 13,14
Weite entne	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentiamille	
"A" Veröffer aber ni "E" älteres I. Armek "L" Veröffen scheine andere soll ode ausgef "O" Veröffer eine Be	a the sate attent shorten beschildren camp angrepen ist (Me	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem is oder dem Prioritätsdahm veröffentlicht vanneldung nicht kolltdert, sondern nurz Erindung zugrundellegenden Prinzips om Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedouts kann ellein aufgrund dieser Veröffentlichter inderischer Tätigkeit beruhend betrack "T" Veröffentlichung von besonderer Bedeuts kann nicht als auf erinderischer Tätigkeit veröffentlicht werden, wenn die Veröffentlichung mit ei Veröffentlichungen die Ser Kategorie in Veröffentlichungen die Ser Kategorie in Veröffentlichung, die Mitglied derselben P	vorden ist und mit der um Verständnis des der der der ihr zugrundellegenden ung; die beanspruchte Erfindung ung nicht als neu oder auf niet werden ung; die beanspruchte Erfindung t beruhend betrachtet ner oder mehreren anderen erbindung gebracht wird und ahellegend ist
Datum des A	bschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rech	erchenberichts
20	9. Mai 2003	0 & 0	E.03
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Daffner, M	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/01651

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. Ansprüche Nr. well sie sich auf Telle der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgelührt werden kann, nämlich
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
siehe Zusatzblatt
Da der Armelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchlerbaren Ansprüche.
2 Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnto, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbertcht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. Ansprüche Nr.
Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt 1, 3-9, 11-14
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1,3-9,11-14

Refraktives Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie bei der alle Linsen aus einem Material bestehen und das Verhältnis der Durchmeser der Lichtbündel bzw. Linsen in einer Linsenanordnung vor einer Blende zum maximalen Durchmesser der Lichtbündel bzw. Linsen mindestens 85% beträgt.

N.B. Die Ansprüche 3-9, 11-14 werden nur insoweit sie sich auf Anspruch 1 beziehen als dieser Gruppe zugehörig betrachtet.

2. Ansprüche: 2,3-9, 11-14

Refraktives Projektionsobjektiv für die Mikrolithographie bei der alle Linsen aus einem Material bestehen und der Quotient (KCHL) aus chromatischem Längsfehler durch Bandbreitenintervall * maximalem Bildfelddurchmesser kleiner als ein Wert ist. N.B. Die Ansprüche 3-9, 11-14 werden nur insoweit sie sich auf Anspruch 2 beziehen als dieser Gruppe zugehörig betrachtet.

3. Ansprüche: 10-14

Projektionsobjektiv welches in drei Linsengruppen unterteilbar ist, wobei sich eine langgestreckte hintere Linsengruppe über 60% der Länge des Projektionsobjektives erstreckt.

N.B. Die Ansprüche 11-14 werden nur insoweit sie sich auf Anspruch 10 beziehen als dieser Gruppe zugehörig betrachtet.

INTERNATIONALER MERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

International Atenzeichen
PCT/EP 03/01651

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19855108	A	31-05-2000	DE WO EP EP JP KR TW US US	19855108 A 0033138 A 1006389 A 1141781 A 2000171706 A 2002531878 T 2000034926 A 480347 B 6349005 B 2003007253 A	1 08-06-2000 2 07-06-2000 1 10-10-2001 23-06-2000 24-09-2002 26-06-2000 21-03-2002 1 19-02-2002
EP 1111425	A	27-06-2001	EP JP TW US US	1111425 A 2001201682 A 448307 B 2002001141 A 2001050820 A	27-97-2901 91-98-2991 1 93-91-2092